

電子線描画装置

製造: 日本電子(株)

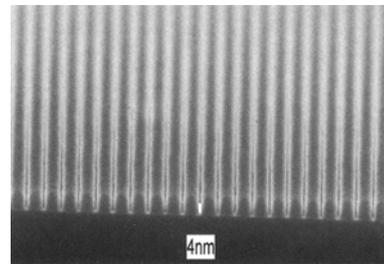
型番: JBX-6300SP

設置場所: 1階101室

機器外観・描画パターン



外観



4 nm描画パターン
日本電子(株) 提供

機器の仕様

特長

- ・高解像度 高精度スポットビームシステム
- ・高加速100kV高解像度ビーム
- ・最大200mmウエハまでロード可能
- ・8nm線幅高解像度描画
- ・自動補正機能(露光量・露光位置)
- ・加速電圧
100kV / 50kV / 25kV
- ・電子銃
ZrO/W
- ・スキャンスピード
50MHz
- ・基板サイズ
200mm最大

研究課題

- ・課題1
半導体微細構造を応用した機能性光源に関する研究
- ・課題2
金属微細構造を応用した光機能素子に関する研究
- ・課題3
半導体微細構造を応用した電子機能素子に関する研究